5.2 Herstellung und Charakterisierung anderer Metalloxide

5.2.a.1 Herstellung von SnO₂

Zinnoxid ist ein Halbleiter mit einer Bandlücke von $E_g = 3.7 \text{ eV}^{240}$ für welches es bereits eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten gibt: als nanostrukturierter chemischer Sensor, 241,242,243,244,245,246,247,248 als optoelektronisches Material und leitendes Oxid (FTO – fluor doped tin oxide) 249,250,251,252,253,254 und als Photokatalysator. Ferner wird es als Kathodenmaterial vorgeschlagen, um die Effizienz von Lithiumionenbatterien zu erhöhen.

Zinnoxid kann über thermische Verdunstung,^{257,258,259,260} oder durch schnelle Oxidation von elementarem Zinn bei verschiedenen Temperaturen hergestellt werden.^{261,262}

In dieser Arbeit wurden die SnO₂-Schichten mittels der Methode von Park²⁶³ hergestellt. Dazu wurden 1.78 g Mikro SnO₂-Pulver, 0.4 g Nano-SnO₂ und 2 g SnCl₄ 5 aq zunächst bei 450 °C 1 h geglüht. Das entstandene Pulver wurde in einem Mörser mit 0.228 g Zn(acetat)₂ 2aq, 2 ml Wasser und 0.5 ml Eisessig gemischt. Der Zusatz von ZnO soll für eine offene Struktur und damit sehr gute Porosität bei den SnO₂-Schichten sorgen. Die Schichten wurden mittels XRD untersucht und charakterisiert (Abbildung 5.27). Der 5% ZnO Anteil ist in der XRD nicht mehr zu sehen.

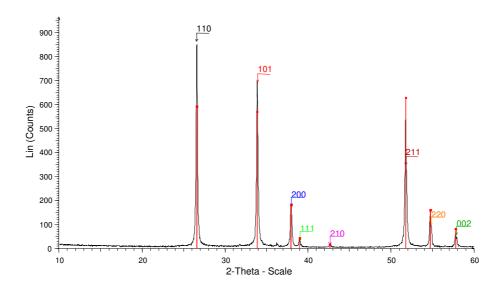


Abbildung 5.27: XRD Spektrum von SnO₂ getempert

Mittels Scherer-Gleichung wurden folgende Partikelgrößen ausgerechnet (Tabelle 6):

Partikelgröße [nm]	Richtung	FWHM	2 Tetha
45.3	110	0.171	26.6
37.1	101	0.205	33.9
32.4	200	0.232	38.0
29.6	211	0.242	51.8
29.4	220	0.24	54.8
30.3	002	0.23	57.8

Bei den SnO₂-Schichten variiert die Partikelgröße von 29.4 nm – 45.3 nm. Diese Werte wurden mit den REM-Aufnahmen verglichen (Abbildung 5.28).

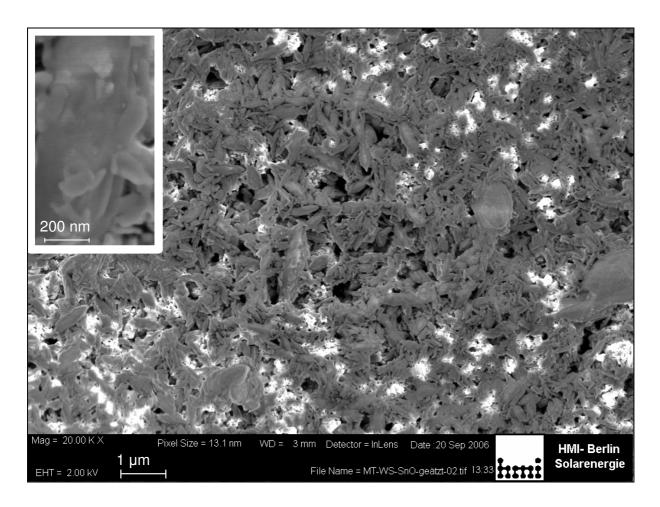


Abbildung 5.28: SEM SnO₂, links oben Vergrößerung

In der Vergrößerung wird deutlich, dass die größeren Platten aus kleineren Partikeln aufgebaut sind, deren Größe etwa doppelt so groß ist wie in der

Partikelgrößenbestimmung in der XRD. Ein anderer wichtiger Morphologieaspekt ist die sehr große Porosität dieser Schicht, welche die Sensibilisierung erst ermöglicht.

5.2.a.2 Herstellung von WO₃

Wolframtrioxid ist ein Halbleiter mit einer Bandlücke von 2.8 eV,²⁶⁴ wessen Besonderheit elektrochromes Verhalten ist.^{265,266,267,268,269}

Prinzipiell finden sich viele Möglichkeiten WO₃-Herstellung, zur Vakuumverdampfung, Sputtern oder Anodisation.²⁷⁰ WO₃-Schichten können durch hergestellt werden,²⁷¹ durch Tempern Oxidieren von gelöstem WOCl₄ Luft²⁷² Ammoniummetawolframat unter oder Wolframsäure in aus Polyethylenglycol. 273,274

In der vorliegenden Arbeit wurde WO₃ nach der Methode von Sayama²⁷⁵ hergestellt. Dazu wurden zuerst aus 3.25 g H₂WO₄ in einer Schale 40 min an der Luft geglüht, so dass 3 g feinteiliges, pulverförmiges WO₃ entstand. Damit aus diesem Pulver gut haftende Suspension entsteht, werden 3 g WO₃-Pulver mit 103 mg^a SnO₂ gemischt, und dann mittels Nazeeruddin²⁷⁶ Methode suspendiert und auf das Substrat gebracht. In Abbildung 5.33 ist das XRD-Spektrum dieser Schicht zu sehen:

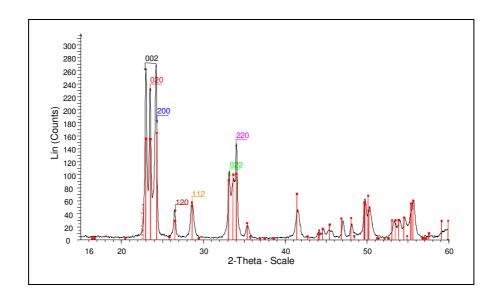


Abbildung 5.29: XRD Spektrum von WO₃ getempert

Die SnO_2 -Suspension wird aus 70 mg $SnCl_4$ 5aq, 13 mg nano- SnO_2 und 60 mg mikro SnO_2 in Eisessig/Wassergemisch (z.B. 0,5 ml/0,5 ml) herzustellen

Mittels Scherer-Gleichung wurden aus den vorliegenden Beugungssignalen folgende Partikelgrößen ausgerechnet (Tabelle 7):

Tabelle 7: Auswertung der Partikelgröße bei WO₃

Partikelgröße [nm]	Richtung	FWHM	2 Tetha
46.7	002	0.167	23.1
39.8	020	0.196	23.6
39.1	200	0.199	24.3
18.9	112	0.408	28.7
53.8	022	0.142	33.2
30.9	220	0.246	34.2

Die WO₃-Partikelgröße variiert zwischen 30.9 nm – 53.8 nm.

Die Schichten wurden mittels REM untersucht.

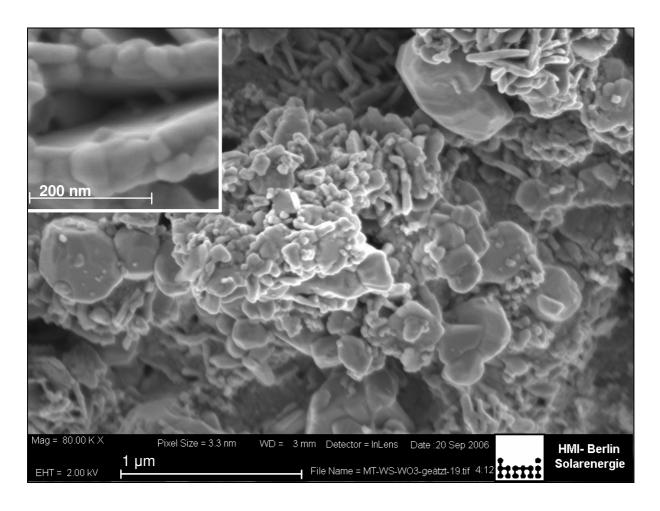


Abbildung 5.30: SEM WO₃, links oben Vergrößerung

Die poröse Struktur dieser Elektrode kann deutlich erkannt werden. Die Schicht ist aus größeren Platten aufgebaut. Diese sind Agglomerate von kleineren Partikeln. Die Größe der kleineren Partikel kann in Vergrößerung mit 46 nm – 61 nm abgeschätzt werden. Dies ist in guter Übereinstimmung mit den aus der XRD abgeschätzten Partikelgrößen.

5.2.a.3 Herstellung von ZnO

Zinkoxid ist ein Halbleiter mit einer ähnlichen Bandlücke wie TiO_2 [$E_g = 3.35 \text{ eV}^{277,278}$]. Dieses Material kann als Katalysator eingesetzt werden, um Wasserstoff zu produzieren, als Gassensor, als optoelektronisches Element oder in Solarzellen.

ZnO Nanopartikel können mit verschiedenen Methoden hergestellt werden, wie z.B. Verdampfen – Kondensieren,²⁸³ aus Lösungen,^{284,285,286} Oxidierung von Zinkpulvern,²⁸⁷ oder Wachsen auf verschiedenen Substraten.²⁸⁸

Für die Herstellung von ZnO-Schichten (Rensmo Methode²⁸⁹) wird zuerst ein ZnO-Pulver hergestellt, welches aus kleinen Teilchen besteht. Es wurden gleiche Mengen einer 1 M Lösung von ZnCl₂ und einer 1 M Lösung von NH₄CONH₂ gemischt. Der entstandene Niederschlag wurde mit H₂O dest. gewaschen und bei 350 ℃ 1 h getempert.

Aus dem Pulver wurde eine Suspension hergestellt (Nazeerudin Methode²⁹⁰). Dazu wurden 6 g des feinteiligen ZnO-Pulvers mit 1.8 ml H₂O und 0.2 ml Acetylaceton in einer Reibschale (bzw. mit einer Ultraschallkanone) homogenisiert. Die so entstandene Suspension wurde mit einem Glasstab auf dem FTO-Substrat verteilt. Die entstandenen Filme wurden mittels XRD untersucht (Abbildung 5.31):

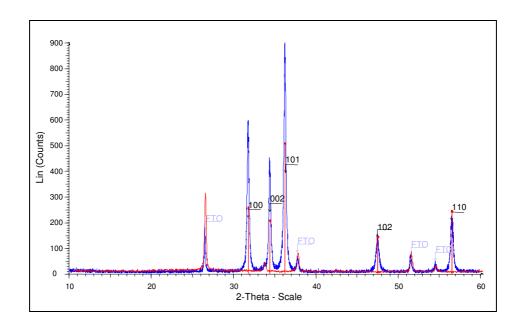


Abbildung 5.31: XRD-Spektrum ZnO-Schicht - blaue Kurve, FTO - rote Kurve

In Abbildung 5.31 ist das XRD-Spektrum des ZnO-Films auf FTO-Glas zu sehen (blau) und im Vergleich dazu das XRD-Spektrum einer reinen FTO-Glas Probe (rot) dargestellt. Aus dem Vergleich können deutlich die ZnO Signale erkannt werden. Die ZnO Signale sowie die zusätzlichen FTO Signale bei der Messung von ZnO-Film wurden gekennzeichnet.

Die Berechnung der Partikelgröße mittels Scherrer-Gleichung aus den Halbwertsbreiten hat ergeben:

Tabelle 8: Größe der ZnO Partikel berechnet mittels Scherer-Gleichung

2 Tetha	FWHM	Richtung	Partikelgröße [nm]
31.8	0.274	100	31.5
34.4	0.273	002	31.8
36.3	0.294	101	29.7
47.5	0.397	102	22.8

Die entstandenen Schichten wurden mittels REM untersucht:

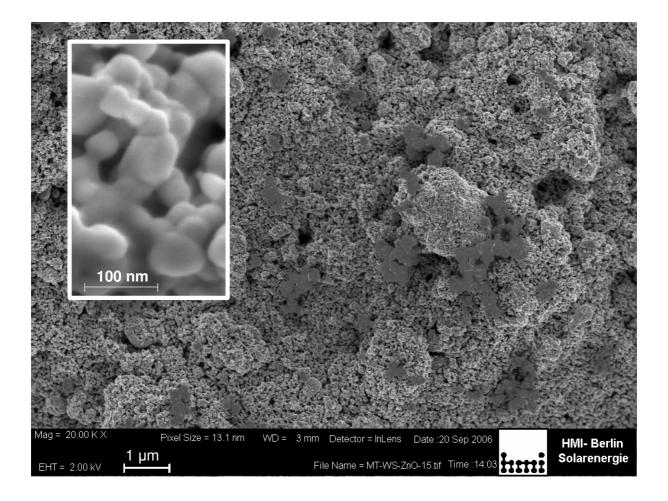


Abbildung 5.32: SEM ZnO-Film

In Abbildung 5.32 ist eine stark zerklüftete, poröse Schicht deutlich zu sehen. Die kleinsten Teilchen, die in der Vergrößerung erkannt werden können, sind 30 nm groß, was mit den XRD-Berechnungen übereinstimmt. Insgesamt ist jedoch die Verteilung der Größe der Teilchen nicht homogen, es sind auch 60 nm große Teilchen zu sehen.

5.3 Herstellung und Charakterisierung der Schichtgitterhalbleiter

Bei der Herstellung der Molybdän- und Wolframsulfide und –selenide kann eine Vielzahl an Verfahren angewendet werden. Die gängigsten dabei sind Gasphasentransport, Zersetzung von $MoS_3^{295,296,297}$ oder von Ammoniumthiomolybdat in einer H_2/H_2S Mischung.

Eine der bekanntesten physikalischen Methoden ist das Sputtern. 300,301

Natürlich kann auch MoO₃ in H₂S sulfurisiert werden, dabei muss es auf eine Temperatur von $400\,^{\circ}\text{C}$ - $650\,^{\circ}\text{C}$ erhitzt werden. 302,303,304,305

Des Weiteren kann dieses Material auch mit Hilfe von Hydrazin als Reduktionsmittel bei moderaten Temperaturen hergestellt werden.³⁰⁶

MoS₂ kann auch hydrothermisch und solvothermisch hergestellt werden. 307,308,309

Eine interessante Möglichkeit wurde von Nikitenko vorgeschlagen, bei der WS₂ Nanostäbchen mit Hilfe von Ultraschall hergestellt werden.³¹⁰ Es ist jedoch bekannt, dass die Molybdän- und Wolframsulfide durch mechanische Belastung ihre photoaktiven Eigenschaften verlieren können. Dies wird mit der Zunahme an Fehlstellen und damit stärkerer Rekombination erklärt. Aus diesem Grund wurde auch die Herstellung von Nanopartikeln in Lösung (Acetonitril) durch mehrmaliges Verdampfen und Ultraschallbehandlung verworfen, die von Petersen vorgeschlagen wird.^{311,312} Während dieser Arbeit wurden auch zahlreiche andere Sulfide und Selenide auf die Möglichkeit der Sensibilisierung geprüft. Da jedoch keine Photoströme festgestellt wurden, wurden diese nicht weiter untersucht. Die Versuchsvorschriften für diese Materialien finden sich im Anhang.

5.3.a Herstellung von WS₂-Nanoröhren ("nano tubes", nach Tremel³⁴³)

In letzter Zeit ist das wissenschaftliche Interesse an Materialien mit Fulleren-ähnlichen Strukturen gestiegen. Insbesondere wurden Molybdän- und Wolframsulfide für die Herstellung von zylinderähnlichen Gebilden verwendet. Die Herstellung erfolgt über elektrische Bogenentladung, kurze elektrische Impulse eines STM Mikroskops, Elektronenstrahl Bestrahlung und Laser Ablation. Es können aber auch Fulleren-ähnliche Partikel mit Hilfe der Sulfurisierung von dünnen Oxidfilmen bei erhöhten Temperaturen (850 °C) hergestellt werden.

Mit Hilfe von asymmetrischen Wolframoxidpartikeln wurden makroskopische Mengen an Wolframsulfidnanoröhrchen hergestellt. 323,324,325,326,327,328,329

MoS₂ Nanoröhrchen wurden durch chemischen Dampftransport erhalten, wobei Brom als Transportmittel verwendet wurde.³³⁰

Eine alternative Herstellungsmethode nutzt Al₂O₃ als Substrat. Dabei wird eine poröse Al₂O₃-Schicht mit Ammoniumtetrathiomolybdat gesättigt und bei hohen Temperaturen unter H₂/N₂ Mischung getempert. In den Poren von Aluminiumoxid bilden sich die Nanoröhrchen, anschließend wird das Substrat mit Hilfe von KOH gelöst, und es bleiben reine Nanoröhrchen übrig.³³¹

Ziel der kontrollierten Herstellung der Nanoröhrchen ist die Entwicklung verbesserter Schmiermittel^{332,333} und neuer Katalysatoren.^{334,335,336} Es wird vermutet, dass MoS₂ aufgrund seiner Fähigkeit zur Lithiuminterkalation in neuen Batterien bzw. zur Wasserstoffspeicherung dienen könnte.^{337,338,339,340}

MoS₂ Nanoröhrchen wurden bereits zur Verbesserung der STM Spitzen erfolgreich eingesetzt.^{341,342}

In der vorliegenden Arbeit wurden WS₂ Nanoröhrchen nach der Methode von Tremel³⁴³ hergestellt. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass makroskopische Mengen an Nanoröhrchen (im Grambereich) produziert werden können.

Dazu wurde zuerst eine Lösung von Ammoniumwolframat $(NH_4)_{10}W_{12}O_{41}^*7H_2O$ und 2.1 g Citronensäure in H_2O (dest.) angesetzt und bei ca. $120\,^{\circ}$ C für $4\,h$ - $5\,h$ bis zur Gelbildung gerührt. Zu diesem Gel wurden 2.45 g von Hexadecylamin in Ethanol gelöst zugegeben und $10\,h$ gerührt. Die entstandene Mischung wurde in einem Autoklaven für $7\,$ Tage bei $180\,^{\circ}$ C gehalten.

Die als Ausgangssubstanz erhaltenen WO₃ Stäbchen hatten in der XRD folgendes Diffraktogram ergeben (Abbildung 5.33):

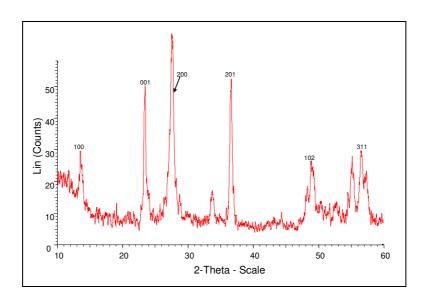


Abbildung 5.33: XRD Spektrum WO₃ Rods

Als stärkste Signale treten deutlich die 100, 001, 200 und 201 Beugungsreflexe des WO₃ hervor. Etwas schwächer sind die 102 und 311 Signale zu sehen.

Nach der Temperung unter H₂S bei ca. 450 °C wurde folgendes Spektrum erhalten:

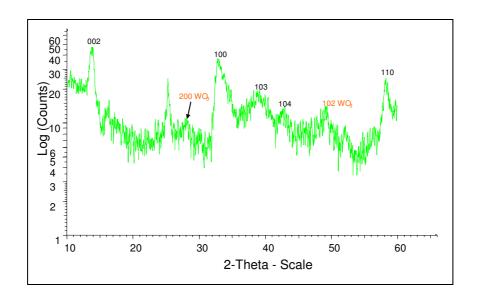


Abbildung 5.34: XRD Spektrum WS₂ Tubes

An den 200 und 102 Reflexen des WO_3 wird deutlich, dass kleinere Reste an WO_3 nicht umgesetzt wurden, vermutlich liegen diese innerhalb der gebildeten WS_2 Nanoröhrchen. Insgesamt spricht das Diffraktogram jedoch für eine nahezu vollständige Umsetzung zu WS_2 , wobei die 002 und 100 Richtung am stärksten ausgeprägt sind.

Die TEM Analyse hat folgendes Bild ergeben:

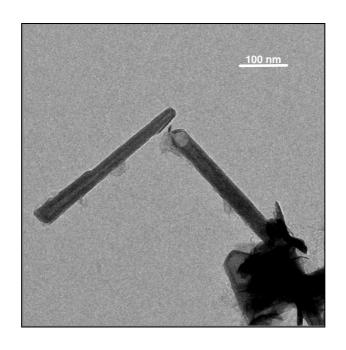


Abbildung 5.35: TEM Aufnahme von WS₂ Röhren

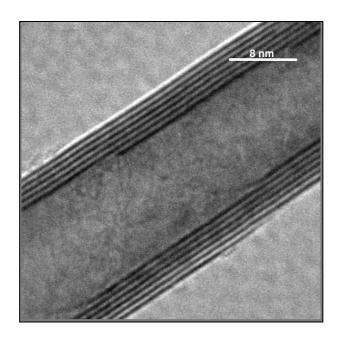


Abbildung 5.36: TEM Vergrößerung von WS₂ Röhren

Es ist deutlich die Schichtstruktur der WS_2 -Röhrchen zu sehen (Abbildung 5.36). Die Wände bestehen aus ca. 6 - 7 Schichten. Die Dicke der Wand beträgt 4 nm – 5 nm. Der Durchmesser des Zylinders beträgt 21 nm und die Länge ca. 450 nm.

5.3.b Herstellung von WS₂ und MoS₂ mit Hilfe "Inverser Mizellen" (Nach Wilcoxon³⁶⁷)

Die verwendete Injektionssolarzelle besteht aus einer nanoporösen TiO₂ Matrix, die mit einem Absorber imprägniert wird. Alternativ sollten Nanoteilchen in die Matrix eingebaut werden. Dieses ist z.B. mit Hilfe der chemischen Badabscheidung geschehen. Es wurde auch versucht bereits fertiges MoS₂ bzw. WS₂ Pulver mit der TiO₂ Suspension zusammen zu mischen und gemeinsam zu sintern. Diese Methode erwies sich aber als nicht durchführbar, weil die so fabrizierten Schichten mechanisch Aus diesem Grund wurde nicht stabil waren. noch nach alternativen Herstellungsmethoden für Nanoteilchen gesucht. Eine immer populärer gewordene Methode ist die Nutzung von Mizellen bzw. inversen Mizellen. 344,345,346,347 Mit Hilfe dieser Methode wurden schon Eisennanopartikel, 348,349 CdS, 350,351,352,353 ZnS, CdSe und PbS, 354 $\mathsf{Gold},^{355}$ II-IV Halbleiter, 356 Metalloxide, 357 und $\mathsf{PtS}_2,^{358}$ erzeugt. Dieses Verfahren wurde auch schon für die Herstellung von MoS₂^{359,360,361,362,363,364} und WS₂³⁶⁵ verwendet. Über die Größe der Nanopartikel lässt sich die Bandlücke des Halbleiters gezielt beeinflussen (Abbildung 5.37, nach Wilcoxon):

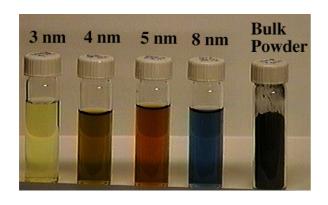
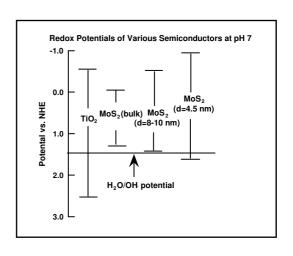


Abbildung 5.37: Links: Suspensionen von MoS₂ Nanopartikeln bestimmter Größe, rechts: Veränderung der Bandlücke mit der Größe der Nanopartikel



Eine Mizelle ist eine kleine Ansammlung von Molekülen, die hydrophile Köpfe und ein alliphatisches Ende haben (Abbildung 5.38). Wenn solche Moleküle in einem organischen Lösungsmittel gelöst werden, ballen sich diese Moleküle zusammen und formen kugelähnliche Gebilde, die mit dem hydrophilen Ende zum Inneren der Kugel ausgerichtet sind, und mit dem alliphatischen Rest nach außen. Über Variation des

Verhältnisses vom Lösungsmittel zum Mizellenbildner kann die Größe der Mizellen verändert werden. Die Mizellen bilden sog. Minireaktoren, in denen sich z.B. hydrophile Substanzen lösen und auch verschiedene Reaktionen ablaufen können. Das einzigartige an Mizellen ist, dass wegen dem begrenzten Volumen der Minireaktoren die in ihnen entstandenen Partikel eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Dadurch ist die Größenverteilung der in inversen Mizellen entstandenen Partikel sehr monodispers, was bei normalen Reaktionen schwierig zu erreichen ist.

In unserem Fall wurden Metallsalze des Molybdäns bzw. des Wolframs gelöst (MoCl₅ und WCl₄, Fluka, Molybdänoxalat³⁶⁶ selbst hergestellt^a) [Nach dem Patent von Wilcoxon³⁶⁷].

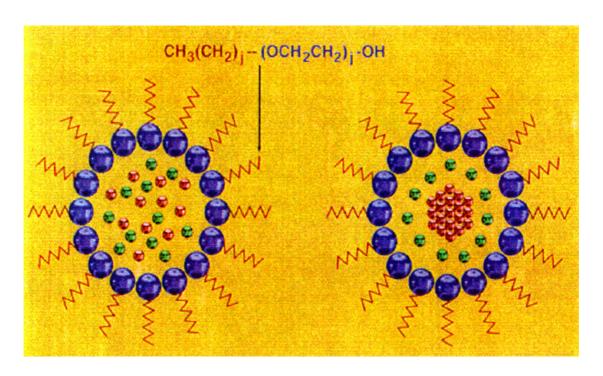


Abbildung 5.38: Schema inverser Mizellen

Die Salze des Metalls lösen sich im hydrophillen Inneren der Mizelle. Als Detergenz wurden verschiedene Stoffe getestet, wie z.B. die im Patent erwähnten Octaethylenglykol-monodecylether (C10E8), Didodecyldimethylammoniumbromide (DDAB, Kodak), Tridodecylmethylammoniumbromid (TMAB), Dodecylpentaethylenglykolether (C12E5) und Natrium di(2-ethylhexyl)sulfosuccinate (Na-AOT). Als Lösungsmittel wurden Oktan, Mischung aus Oktan und Hexanol, und

_

^a Um Molybdänoxalat herzustellen wurden 3 mmol Oxalsäure und 3 mmol Ammoniumheptamolybdat, jeweils in H₂O, gemischt

Nonan verwendet. Na₂S, Thioacetamid und Ammoniumsulfid dienten variabel als Schwefelquellen.

Da das Molybdän in MoCl₅ nicht die gleiche Oxidationsstufe hat wie in MoS₂, wurden auch unterschiedliche Reduktionsmittel getestet, wie Hydrazin und Propandiol.

Es wurde auch versucht, aus MoCl₅ MoCl₄ herzustellen. Damit sollte die Reduktion des MoV zu MoV vermieden werden, und das erwünschte MoS₂ direkt aus der richtigen Oxidationsstufe IV hergestellt werden. Dazu wurde MoCl₅ in 100 ml Benzol bei 130 ℃ in einem Autoklaven erhitzt. Das entstandene Produkt wurde mit Benzol gewaschen und im Vakuum getrocknet.

Zur Herstellung der Nanopartikel aus WS₂ und MoS₂ wurde eine Schlenkapparatur, ähnlich der in Abbildung 5.39 schematisch dargestellten, verwendet:

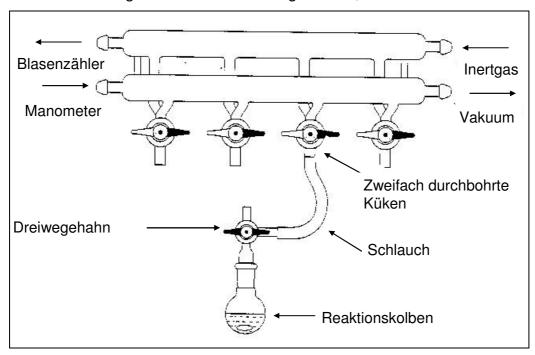


Abbildung 5.39: Schlenkapparatur

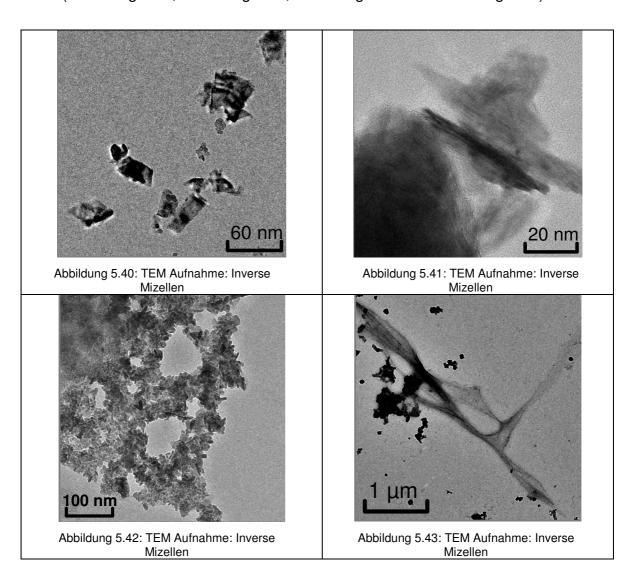
Der verwendete Aufbau hatte allerdings einen Dreihalskolben, so dass separate Anschlüsse für Inertgas (Stickstoff) und zur Vakuumpumpe vorhanden waren.

Zuerst wurde das Lösungsmittel mit Inertgas gespült und anschließend durch das Anlegen eines leichten Vakuums entgast. Danach wurde die Detergenz zugegeben. Es wurden verschiedene Verhältnisse Detergenz/Lösungsmittel getestet, die zwischen 1:10 und 1:100 lagen. Nach Lösen der Detergenz wurden MoCl₅, MoCl₄ bzw. WCl₄ zugegeben (1 – 5 mmol). Entgegen der Patentbeschreibung wurden diese Salze in der

Mizellenlösung nicht vollständig gelöst. Es wurde getestet, inwieweit eine Zugabe unterschiedlicher Schwefelquellen (Na_2S , 2-10 mmol) zum gewünschten Produkt führte. Die so entstandene Lösung wurde 1 h-2 h gerührt und später mit TEM untersucht.

In manchen Fällen wurde auch $H_2S(g)$ als Schwefelquelle getestet, dieses wurde durch die Lösung geleitet. Trotz der zahlreichen Variationen im Reaktionsansatz konnten keine Nanopartikel nachgewiesen werden. Dies ist vermutlich auf die extreme Sauerstoffempfindlichkeit der hygroskopischen Mo- und W-Salze zurückzuführen. Die Verwendung einer Glove-Box könnte eventuell Abhilfe schaffen. Dies konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr getestet werden.

Einige Beispiele der entdeckten Gebilde sind in den folgenden TEM-Aufnahmen zu sehen (Abbildung 5.40, Abbildung 5.41, Abbildung 5.42 und Abbildung 5.43):



5.3.c Elektrochemische Abscheidung von WS₂

Es ist bekannt, dass viele Halbleiter auch elektrochemisch erfolgreich abgeschieden werden können. So wurden z.B. CdTe,^{369,370} CdS,^{371,372,373,374,375,376} CdSe³⁷⁷ und Cul³⁷⁸ hergestellt.

Es wurde auch von der elektrochemischen Abscheidung von WS_2^{379} und $MoS_2^{380,381,382,383,384}$ berichtet.

Da die Abscheidung in der vorliegenden Arbeit nicht auf leitfähigem Material sondern auf der porösen, halbleitenden TiO₂ Elektrode erfolgen sollte, wurde auch die Literatur zur elektrochemischen Abscheidung in porösen TiO₂-Strukturen ausgewertet, diese bezog sich im Wesentlichen auf Abscheidungen von Cu₂O,³⁸⁵ Cul und CuSCN.³⁸⁶ Es konnte jedoch keine Literatur zur elektrochemischen Abscheidung von WS₂ bzw. MoS₂ in porösem TiO₂ gefunden werden.

Es wurde herausgefunden, dass die Rauhigkeit des Substrats eine wichtige Rolle beim Abscheiden der Schichten spielt. Als nämlich versucht wurde, WS₂ Filme auf Metall oder glattem FTO herzustellen, sind die Filme noch in der Lösung abgeblättert, und konnten somit nicht hergestellt werden. Als Substrate wurden verwendet: Kupfer, Tantal, Stahl, Aluminium, Vanadium, Nickel und Zinn.

Es wurde versucht, WS₂ nach der Methode von J. Devadasan herzustellen.³⁷⁹ Bei dieser Methode wurden jedoch fälschlicherweise Zinn-Signale mit WS₂-Signalen verwechselt. Es entsteht dabei außerdem noch WO₂.

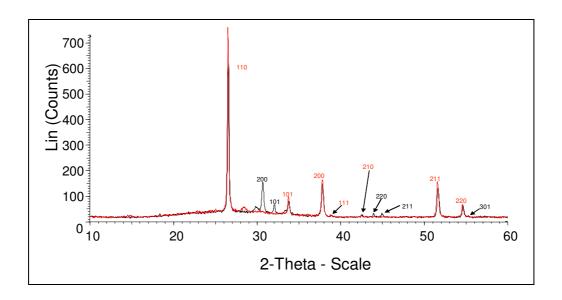


Abbildung 5.44: XRD Spektrum Kathodische Abscheidung WS₂, rot-Signale von SnO, schwarz-Signale von Zinn

In Abbildung 5.44 können außer den üblichen FTO Reflexen 5 zusätzliche Peaks erkannt werden. Diese Signale sind in guter Übereinstimmung mit Zinnbeugungspeaks. Anscheinend wird das leitende Zinnoxid bei der kathodischen Abscheidung teilweise zu Zinn reduziert. Ein weiterer Hinweis für die Richtigkeit dieser

Erklärung ist, dass bei späteren Kontrollabscheidungen bei höheren kathodischen Potentialen (negativer) genau diese Reflexe sich verstärkt haben.

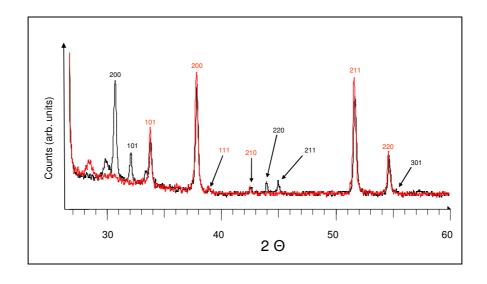


Abbildung 5.45: Vergrößerung der XRD Messung von WS_2 -kathodische Abscheidung

Die gleiche Probe wurde getempert. Nach dem Tempern verschwanden die Zinnsignale (vergrößert in Abbildung 5.45, rote Linie). Dies war ein weiterer Hinweis auf die Anwesenheit von Zinn in der Probe.

Es wurde nun eine neue Methode ausprobiert, die ähnlich der von Levy-Clement³⁸⁰ war. Diese reduziert Ammoniumtetrathiomolybdat gemäß folgender Gleichung zu MoS₂:

$$MoS_4^{2-} + 2e^- + 4H^+ \rightarrow MoS_2 + 2H_2S$$

Zur Herstellung von WS₂ wurde diese Methode durch die Verwendung von Ammoniumtetrathiowolframatlösung abgewandelt und kathodisch WS₂ abgeschieden. Die so entstandene Schicht war dunkel grau bis schwarz und XRD amorph. Auch die getemperten Schichten (450°C, Argon, 1 h) zeigten in der XRD keine charakteristischen WS₂ Signale, weil die Kristallitgröße vermutlich zu klein ist. Es wurde versucht, die Schicht mit Hilfe von streifendem Einfall in der XRD zu untersuchen (GIXRD, "Grazing Incidence" XRD). Dabei wurde der Einfallswinkel der Röntgenstrahlen möglichst klein gewählt, damit nur die obersten Atomlagen der Probe bestrahlt wurden. Dadurch wurde sichergestellt, dass nicht das darunter liegende Substrat die Messsignale überdeckt. Als Einfallswinkel wurde für diese Untersuchung 0.2°, 0.4°, 0.8°, 1.6°, 3.2° und 6.4° ausgewählt und als Akkumulationszeit 12 h, um zu sichern, dass auch die schwächsten Signale noch gemessen werden können.

Das Ergebnis dieser Messung ist in Abbildung 5.46 gegeben:

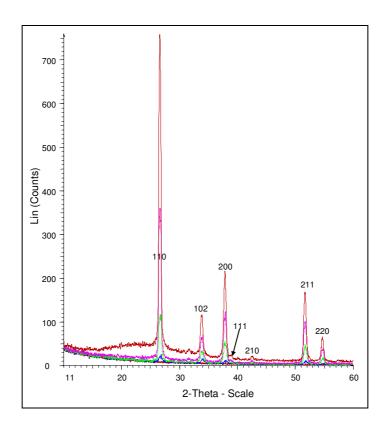


Abbildung 5.46: Streifender Einfall XRD Spektren, Einfallswinkel 0.2°, 0.4°, 0.8°, 1.6°, 3.2°, 6.5°, von schwarz zu braun

Es sind deutlich die mit größerem Einfallswinkel stärker werdenden Zinnoxidsignale zu erkennen. In Abbildung 5.47 wurde der 102 Reflex vergrößert dargestellt:

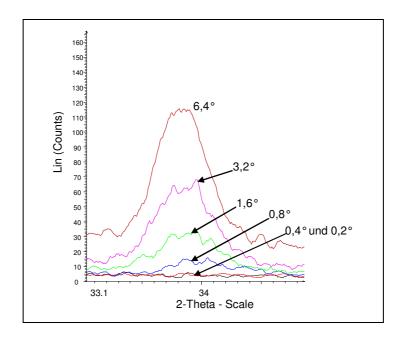


Abbildung 5.47: XRD Spektrum Streifender Einfall, Vergrößerung von Peak 102 FTO

Erst ab einem Einfallswinkel von 0.8° lieferte die XRD Messung Beugungssignale. Damit konnte ausgeschlossen werden, dass die Röntgenstrahlung die Probe nicht trifft und der kleinste mögliche Winkel (0.8°) für derartige Messung wurde festgestellt. Leider war auch hier kein XRD Signal von WS₂ zu erkennen. Das Fehlen von XRD Signalen konnte aber auch darauf deuten, dass unsere elektrochemisch abgeschiedenen Schichten amorph bzw. polykristallin sind (sehr kleine Kristalle unter 5 nm können in der XRD nicht mehr nachgewiesen werden).

Die Abscheidung wurde hinsichtlich der Parameter pH, Temperatur und Lösungsmittel optimiert. Die Schichten wurden außerdem mit Hilfe von Absorptionsmessungen und Dickenbestimmung charakterisiert. Die Dickenbestimmung mit Hilfe des Dectac Profilometers hat sich als schwierig erwiesen, da das Substrat an sich schon eine hohe Rauhigkeit von bis zu 400 nm aufweist und nicht eben, sondern gekrümmt vorliegt. Hier ein Beispiel für eine Dickenbestimmung (Abbildung 5.48):

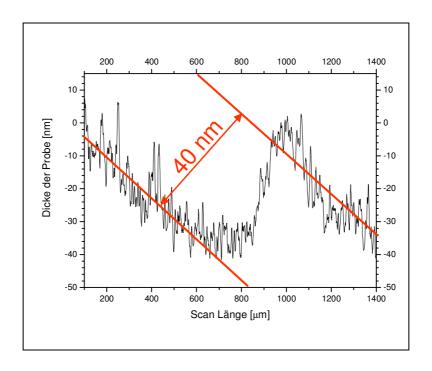


Abbildung 5.48: Dectac Dickenbestimmung einer elektrochemisch abgeschiedenen Probe

Die Dicke der Probe wurde in diesem Fall zu 40 nm abgeschätzt. An diesem Beispiel kann deutlich die Rauhigkeit der FTO-Schicht erkannt werden (ca. 30 nm) als auch die Verbiegung des Substrats.

Die Dicken der Schichten betragen bis zu 250 nm, wobei sich die Bestimmung als kompliziert erwies, da die FTO-Substrate keine ebene Oberfläche aufweisen.

Die Zusammensetzung der Schicht wurde für beide Abscheideverfahren mittels ERDA untersucht. Da die Rauhigkeit der Probe sehr hoch ist, konnten keine Tiefenprofile der Zusammensetzung erstellt werden. Nichtsdestotrotz haben diese Messungen die Vermutung bestätigt, dass nur bei der elektrochemischen Abscheidung aus Ammoniumtetrathiowolframat das Verhältnis von W:S eher den gewünschten 1:2 entspricht. Bei der Methode von Devadasan konnte kein bzw. nur wenig Schwefel festgestellt werden. Dies spricht noch mal für die Vermutung, dass dabei kein WS₂ entsteht, sondern WO₃.

Tabelle 9: ERDA-Messung der Zusammensetzung der elektrochem. abgeschiedenen Schichten

	Sn [%]	O [%]	W [%]	S [%]	H [%]	C [%]	Sn:O	W:S
Devadasan	30	51.1	9	1	5	2.8	1:1.7	9:1
Devadasan	24.5	52.6	5.7	1.4	8.4	4.7	1:2.14	4.1:1
getempert								
Levy-								
Clement	40	46.1	2.7	3.2	7	1	1:1.15	1:1.2
(mit WS_4^{-2})								

In der Tabelle 9 sind die Ergebnisse der ERDA Messung dargestellt. Aus diesen Messungen kann erkannt werden, dass nur bei der letzten Probe das Sn:O-Verhältnis 1:1 ist. Dies entspricht der Zusammensetzung des FTO Kontakts (Fluor dotiertes Zinnoxid, SnO₂), bei den anderen Proben (Devadasan Methode), ist der Anteil an Sauerstoff erhöht. Dies kann als ein Hinweis auf die Anwesenheit von WO₂ gedeutet werden. Bei der Levy-Clement Probe ist das Verhältnis an Sn:O fast 1:1, es ist also kein zusätzlicher Sauerstoff vorhanden.

Das W:S Verhältnis ist bei der Levy-Clement Methode viel günstiger (1:1.2) und entspricht mehr der idealen Stöchiometrie von 1:2, wobei immer noch ein Schwefeldefizit festzustellen ist. Bei den anderen Proben unterscheidet sich das Verhältnis von W:S sehr stark von der idealen Zusammensetzung (9:1).

5.3.d Carbonylmethode (WS₂, MoS₂, WSe₂, MoSe₂) (nach Chatzitheodorou³⁸⁷)

Während dieser Arbeit hat sich herausgestellt, dass die erfolgreichste Methode um TiO₂ mit Sulfiden und Seleniden des Wolframs und des Molybdäns zu beschichten von Chatzitheodorou³⁸⁷ entwickelt wurde. Bei dieser Methode werden Metallhexacarbonyle mit einer Schwefelquelle in organischem Lösungsmittel erhitzt.

Es wurden verschiedene organische Lösungsmittel mit unterschiedlichen Siedepunkten verglichen. Die Idee dabei war, dass vielleicht bei Abscheidungen bei höheren Temperaturen die Kristallinität der Absorber stärker ausgeprägt ist. Zu den Lösungsmitteln gehörten: Mesitylen (163°C), eingesetzten Cymen (178℃) Dichlorbenzol (180℃), Naphthalin (218℃) Biphenyl (Siedepunkt 255 ℃), Diphenylamin (302°C) und Pyren (393°C). Es konnte allerdings nur bei Verwendung von Cymen und Dichlorbenzol ein Photostrom gemessen werden.

Bei der Badabscheidung mit Cymen wurden unterschiedliche Konzentrationsverhältnisse der Ausgangsstoffe W(CO)₆ (Wolframhexacarbonyl) bzw. Mo(CO)₆ (Molybdänhexacarbonyl) und Schwefel getestet. Dabei hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, mit einem Überschuss an Schwefel zu arbeiten (Verhältnis W:S 1:10).

Bei den meisten Abscheidungen wurden zuerst 0.52 g Schwefel (M[S] = 32.06 g/mol) in 20 ml Cymen gelöst (0.324 mmol). Das Lösungsmittel wurde dabei bis auf Siedetemperatur erhitzt. Die porösen TiO₂ Substrate wurden kurz vor der Abscheidung auf ca. 200 ℃ erhitzt, um Reste von Wasser aus der Schicht zu verdampfen, danach wurden die Substrate in die kochende Schwefellösung schräg hineingestellt. Nach ca. $W(CO)_6$ $(M[W(CO)_6] = 351.91g/mol)$ Minute wurden $0.64 \, q$ (0.0362 mmol). Die gelbliche Schwefellösung verfärbte sich sofort dunkelbraun bis schwarz. Das Substrat wurde 30 s bis 2 min in dieser Lösung gehalten, anschließend mit Aceton abgespült und in einem Exiccator getrocknet. Diese Abscheidung wurde 5mal wiederholt. Danach waren die Schichten gleichmäßig dunkelbraun bis schwarz. Bei der Herstellung von WSe₂ und MoSe₂ wurde der Schwefel durch Selen ersetzt. Ansonsten war die Vorgehensweise gleich.

Bei der Herstellung von WS₂ mit Hilfe der Carbonylmethode wurden Abscheideparameter wie Lösungsmittel, Konzentration an Schwefel, Dauer und Anzahl an Abscheidungen optimiert.